

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-075238

(43)Date of publication of application : 18.03.1994

(51)Int.Cl.

G02F 1/1343

G02F 1/1333

G02F 1/1335

G02F 1/136

G09F 9/30

(21)Application number : 04-240935

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing : 09.09.1992

(72)Inventor : MITSUI SEIICHI
KIMURA TADASHI
NAKAMURA HISAKAZU
KANBE MAKOTO
SHIMADA YASUNORI

(30)Priority

Priority number : 03230608

Priority date : 10.09.1991

Priority country : JP

03316667

29.11.1991

04177096

03.07.1992

JP

JP

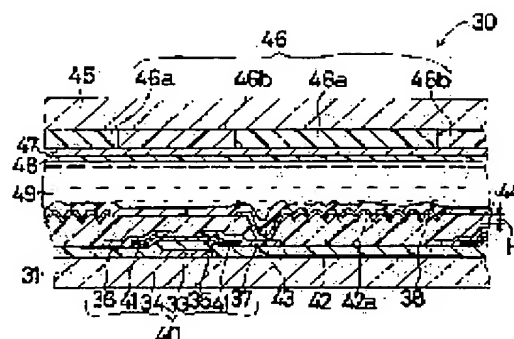
(54) REFLECTION-TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the display grade of a reflection-type liq. crystal display device.

CONSTITUTION: An org. insulating film 42 is formed on the thin-film transistor 40 formed on a substrate 31. A contact hole 43 and a protrusion 42a are formed when the reflecting electrode 38 of the insulating film 42 is formed. The reflecting electrode 38 is formed thereon, and the drain electrode 32 and the reflecting electrode 38 are connected through the contact hole 43.

Accordingly, since the protrusion 42a is formed only on the reflecting electrode 38, the patterning of the reflecting electrode 38 is improved, defective insulation is not caused between a source bus wiring 36 and the reflecting electrode 38, and the display grade is improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.07.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2825713

[Date of registration] 11.09.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(9)日本特許庁(JP) (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-75238

(43)公開日 平成6年(1994)3月18日

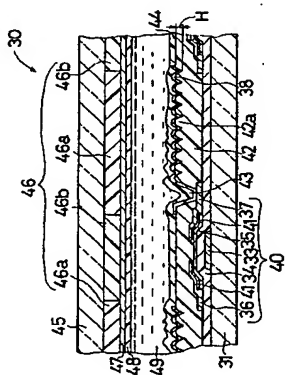
(51)IntCl. ⁴	G 0 2 F	1/1343	1/1333	1/1335	1/136	G 0 9 F	9/30	5 0 5	8302-2K	9225-2K	9225-2K	6447-5G
発明の名称	反射型液晶表示装置およびその製造方法	特開平3-230608	日本(JP)	特開平3-316607	日本(JP)	特開平4-177096	日本(JP)	平4(1992)7月3日	平4(1992)7月3日	平4(1992)7月3日	平4(1992)7月3日	平4(1992)7月3日

(21)出願番号	特開平4-240935	(71)出願人	000005049
(22)出願日	平成4年(1992)9月9日	(72)発明者	三ツ井 精一
(31)優先権主張番号	特開平3-230608	(73)発明者	木村 直史
(32)優先日	平3(1991)9月10日	(74)代理人	弁理士 西教 圭一郎
(33)優先権主張国	日本(JP)		
(31)優先権主張番号	特開平3-316607		
(32)優先日	平3(1991)11月29日		
(33)優先権主張国	日本(JP)		
(31)優先権主張番号	特開平4-177096		
(32)優先日	平4(1992)7月3日		
(33)優先権主張国	日本(JP)		

(54)【発明の名称】 反射型液晶表示装置およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 反射型液晶表示装置の表示品位を向上する。
【構成】 基板31上に形成された薄膜トランジスタ40上に有機絶縁膜42を形成し、有機絶縁膜42の反射電極38形成時にコンタクトホール43と凸部42aとを形成する。この上に反射電極38を形成し、ドレイン電極37と反射電極38とはコンタクトホール43を介して接続される。
【効果】 反射電極38部分のみに凸部42aが形成されるため、反射電極38のメタレーシングが良好となり、またソースバス配線36と反射電極38との間の絶縁不良が生じず、表示品位が向上する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶層を介在して対向配置される一対の透明基板のうち、一方基板上の液晶層側表面には、他方基板側からの入射光を反射する表示絶縁膜である複数の反射電極と、各反射電極に表示のための電圧を印加する引回し電極とを形成し、他方基板上の液晶層側表面には、ほぼ全面にわたって透光性を有する共通電極を形成して構成される反射型液晶表示装置において、

前記反射電極は、一方基板上に形成された引回し電極上の反射電極との接続部分を除く基盤全面を覆い、かつ引回し電極と重ならない反射電極形成領域のみに複数の凸部を有する電気絶縁膜上に形成されていることを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項2】 前記凸部は、不規則に配列されることを特徴とする請求項1記載の反射型液晶表示装置。

【請求項3】 前記凸部は、先端状に、かつ先端部は球面状に形成されることを特徴とする請求項1または2記載の反射型液晶表示装置。

【請求項4】 前記凸部は、1種類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成ることを特徴とする請求項1、2または3記載の反射型液晶表示装置。

【請求項5】 前記凸部の高さは、10μm以下であることを特徴とする請求項1、2、3または4記載の反射型液晶表示装置。

【請求項6】 前記凸部の配列パターンが、各反射電極において同一であることを特徴とする請求項1、2、3、4または5記載の反射型液晶表示装置。

【請求項7】 前記一方基板上に形成された引回し電極上の反射電極との接続部分側および引回し電極上の反射電極と重ならない領域に、電気絶縁性を有する透光膜を形成することを特徴とする請求項1、2、3、4、5または6記載の反射型液晶表示装置。

【請求項8】 液晶層を介在して対向配置される一対の基板の一方基板上に、他方基板側からの入射光を反射する反射電極を有する反射型液晶表示装置において、前記反射電極は、一方基板上の液晶層側に不規則に配列された複数の凸部上に形成された電気絶縁膜上に形成されていることを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項9】 前記一方基板上の液晶層側に不規則に配列された複数の凸部は、1種類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成ることを特徴とする請求項8記載の反射型液晶表示装置。

【請求項10】 前記一方基板上の液晶層側に不規則に配列された複数の凸部は、先端状に、かつ先端部は球面状に形成されることを特徴とする請求項8記載の反射型液晶表示装置。

【請求項11】 前記複数の凸部上に形成された電気絶縁膜の凸部の高さは、10μm以下であることを特徴とする請求項8記載の反射型液晶表示装置。

【請求項12】 前記反射電極は、前記一方基板上の液晶

層側に不規則に配列される前記複数の凸部の断面形状の最大直径は20μm以下であり、反射電極表面積の40%以上を占めることを特徴とする請求項8記載の反射型液晶表示装置。

【請求項13】 前記反射電極は、表示絶縁膜となる電極であることを特徴とする請求項8記載の反射型液晶表示装置。

【請求項14】 液晶層を介在して対向配置される一対の基板の一方基板上に、他方基板側からの入射光を反射する反射電極を有する反射型液晶表示装置の製造方法において、

前記一方基板上の液晶層側に感光性樹脂を塗布し、前記感光性樹脂を円形の透光領域が不規則に配列された透光手段を介して露光および現像した後熱処理を行い、得られた複数の凸部上に前記複数の凸部に沿う絶縁膜を形成し、絶縁膜上に金属薄膜から成る前記反射電極を形成することを特徴とする反射型液晶表示装置の製造方法。

【請求項15】 前記透光手段は、前記円形の透光領域の絶縁膜が反射電極表面積の40%以上であり、かつ不規則に配列される前記円形の直径が20μm以下であることを特徴とする請求項14記載の反射型液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、外部からの入射光を反射することによって表示を行う反射型液晶表示装置およびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、ワードプロセッサ、ラップトップ型パーソナルコンピュータ、ポケットテレビなどへの液晶表示装置の応用が急速に進んでいる。特に、液晶表示装置の中でも外部から入射した光を反射させて表示を行う反射型液晶表示装置は、バックライトが不要であるため消費電力が低く、薄形であり、軽量化が可能であるため注目されている。

【0003】 従来から、反射型液晶表示装置にはTN(ツイステッドネマティック)方式、ならびにSTN(スーパーツイステッドネマティック)方式が用いられているけれども、これらの方式では偏光板によって必然的に自然光の透過度の1/2が表示に利用されないことになり、表示が暗くなるという問題がある。

【0004】 このような問題に対して、偏光板を用いず、自然光の全ての光線を有効に利用しようとする表示モードが提案されている。このようなモードの例として、相転移型ゲスト・ホスト方式が挙げられる(D. L. White and G. N. Taylor: J. Appl. Phys. 45, 4718 (1974))。このモードでは、電界によるコレステリック・ネマティック相転移現象が利用されている。この方式に、さらにマイクロカプラーフィルムを組合わせた反射型マルチカラーディスプレイも提案されている。

る (Tohru Koizumi and Tatsuo Uchida Proceedings of the SID, Vol. 29/2, 157, 1988)。

[0005] このような偏光板を必要としないモードでさらに明るく表示を得るためには、あらゆる角度からの入射光に対し、表示面が垂直な方向へ散乱する光の強度を増加させる必要がある。そのためには、最速な反射特性を有する反射板を作成することが必要となる。上述の文獻には、ガラスなどから成る基板の表面を研削剤で粗面化し、フッ化水素酸でエッチングする時間を変えることによって表面の凹凸を制御し、その凹凸上に導の溝を形成した反射板について記載されている。

[0006] しかしながら、上記文獻に記載の反射板には、ガラス基板に研削剤によって傷をつけることによって凹凸が形成されるため、均一な形状の凹凸が形成されない。また、凹凸の形状の再現性が悪いという問題があるため、このようなガラス基板を用いると再現性よく良好な反射特性を有する反射型液晶表示装置を提供することができない。

[0007] 図25は、アクティブマトリクス方式に用いられるスイッチング素子である薄膜トランジスタ(以下、「TFT」と記す。)1を有する基板26-X26-Aであり、図26は図25に示す切斷面線X26-X26-Aから見た断面図である。ガラスなどの絶縁性の基板26上に、クロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線3が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線3からは、ゲート電極4が分岐して設けられている。ゲートバス配線3は、走査線として機能している。

[0008] ゲート電極4を覆って基板26の全面に窒化シリコン(SiN_x)、酸化シリコン(SiO₂)などから成るゲート絶縁膜5が形成されている。ゲート電極4の上方のゲート絶縁膜5上には、非晶質シリコン(以下、「a-Si」と記す。)、多結晶シリコン、CdSeなどから成る半導体層6が形成されている。半導体層6の一方の端部には、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極7が重畳形成されている。また、半導体層6の他方の端部には、ソース電極7と同様にチタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るドレイン電極8が重畳形成されている。ドレイン電極8の半導体層6とは反対側の端部には、ITO (Indium Tin oxide) から成る従来電極9が重畳形成されている。

[0009] 図25に示すように、ソース電極7にはゲートバス配線3と前述のゲート絶縁膜5を挟んで交差するソースバス配線10が接続されている。ソースバス配線10は、信号線として機能している。ソースバス配線10も、ソース電極7と同様な金属で形成されている。ゲート電極4、ゲート絶縁膜5、半導体層6、ソース電極7およびドレイン電極8は、TFT1を構成し、該TFT1はスイッチング素子としての機能を持っている。

[0010] 図25および図26に示すTFT1を有する基板26を反射型液晶表示装置に適用しようとするれば、

従来電極9をアルミニウム、銀などの光反射性を有する金属で形成するばかりでなく、ゲート絶縁膜5あるいはその上に凹凸を形成する必要がある。一般に、無機物から成る絶縁膜にテーパのついた凹凸を均一に形成することは困難である。

[0011] 図27は、アクティブマトリクス方式に用いられるTFT1を有する基板12の平面図であり、図28は図27に示される切斷面線X28-X28-Aから見た断面図である。ガラスなどの絶縁性の基板12上に、クロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線13が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線13からは、ゲート電極14が分岐して設けられている。ゲートバス配線13は、走査線として機能している。

[0012] ゲート電極14を覆って基板12上の全面に窒化シリコン、酸化シリコンなどから成るゲート絶縁膜15が形成されている。ゲート電極14の上方のゲート絶縁膜15上には、a-Siなどから成る半導体層16が形成されている。半導体層16の両端部には、a-Siなどから成るコンタクト層17が形成されている。一方のコンタクト層17上にはソース電極18が重畳形成され、他方のコンタクト層17上には、ドレイン電極19が重畳形成されている。ソース電極18には、ゲートバス配線13と前述のゲート絶縁膜15を挟んで交差する信号線として機能するソースバス配線23が接続されている。ゲート電極14、ゲート絶縁膜15、半導体層16、コンタクト層17、ソース電極18およびドレイン電極19は、TFT11を構成する。

[0013] さらにその上に複数の凸部20aを有し、ドレイン電極19上にコンタクトホール21を有する有機絶縁膜20が形成される。有機絶縁膜20上には、反射電極22が形成され、反射電極22はコンタクトホール21を介してドレイン電極19と接続されている。[0014] 以上のように、TFT11を形成した基板12上に有機絶縁膜20を形成する場合は、エッチング法を用いて有機絶縁膜20の表面に凸部20aを容易に形成することができ、凸部20aを有する有機絶縁膜20上に反射電極22を形成することによって、容易に凹凸を有する反射電極22を形成することができる。

[0015] [発明が解決しようとする課題] 図25および図26に示されるように、反射電極9とソースバス配線10とをゲート絶縁膜5上に形成する際には、反射電極9とソースバス配線10とが導通しないように間隙9aが形成される。しかしながら、図27および図28に示されるように、ソースバス配線23をゲート絶縁膜15上に、反射電極22を有機絶縁膜20上にそれぞれ形成すれば、前述のような間隙9aは不要である。

[0016] 表示の輝度を向上するためには、反射電極22はその表面積が大きいほど好ましい。したがって、図27および図28では反射電極22端部は、有機絶縁

膜20を介してソースバス配線23上に形成されている。[0017] 有機絶縁膜20は、凸部20aを有しているため、隣り合う凸部20a間の底部20b部分がソースバス配線23上に接触するエッチング不良が生じた場合、有機絶縁膜20による絶縁が行われず、有機絶縁膜20上に形成される反射電極22とソースバス配線23との絶縁不良が生じるという問題がある。

[0018] また、基板12上の全面に凸部20aを有する有機絶縁膜20を形成するため、反射電極22をパターニングする際、凸部20aによって反射電極22の周縁部に凹凸が生じ、反射電極22のパターニング不良が生じるという問題がある。

[0019] さらに、反射電極22が、基板12上に形成された引出し電極であるゲート電極14上の接続部分の半導体層16の上に有機絶縁膜20を介して形成された場合、反射電極22にかかる信号が半導体層16にかかり、疑似的に反射電極22がゲート電極14と同じような機能を果たし、反射電極22と半導体層16との界面にチャネルを形成してしまい、TFT11の特性を低下させる。また、ゲート電極14と反射電極22との間に、大きな寄生容量が発生することになる。これらの現象は、表示品位を低下させる原因となる。

[0020] 本発明の目的は、上述の問題を解決し、良好な反射特性を有する反射板を容易に、かつ再現性よく作成することができ、表示品位が向上する反射型液晶表示装置およびその製造方法を提供することである。

[0021] [課題を解決するための手段] 本発明は、液晶層を介して対向配置される一対の透明基板のうち、一方基板上の液晶層側表面には、他方基板側からの入射光を反射する表示素子である複数の反射電極と、各反射電極に形成するための電圧を印加する引出し電極とを形成し、他方基板上の液晶層側表面には、ほぼ全面にわたって透光性を有する共通電極を形成して構成される反射型液晶表示装置において、前記反射電極は、一方基板上に形成された引出し電極上の反射電極との接続部分を除く基板全面を覆い、かつ引出し電極と重ならない反射電極形成領域のみに複数の凸部を有する電気絶縁膜上に形成されていることを特徴とする反射型液晶表示装置である。

[0022] また本発明は、前記凸部は、不規則に配列されることを特徴とする。

[0023] また本発明は、前記凸部は、先端状に、かつ先端部は球面状に形成されることを特徴とする。

[0024] また本発明は、前記凸部は、1個層あるいは大きな異なる2個層以上の形状から成ることを特徴とする。

[0025] 本発明は、前記凸部の高さは、10μm以下であることを特徴とする。

[0026] 本発明は、前記凸部の配列パターンが、各

反射電極において同一であることを特徴とする。

[0027] 本発明は、前記一方基板上に形成された引出し電極上の反射電極との接続部分領域および引出し電極上の反射電極と重ならない領域に、電気絶縁性を有する透光膜を形成することも特徴とする。

[0028] また本発明は、液晶層を介して対向配置される一対の基板の一方基板上に、他方基板側からの入射光を反射する反射板を有する反射型液晶表示装置において、前記反射板は、一方基板上の液晶層側に不規則に配列された複数の凸部に形成された電気絶縁膜上に形成されていることを特徴とする反射型液晶表示装置である。

[0029] また本発明は、前記一方基板上の液晶層側に不規則に配列された複数の凸部は、1個層あるいは大きな異なる2個層以上の形状から成ることを特徴とする。

[0030] また本発明は、前記一方基板上の液晶層側に不規則に配列された複数の凸部は、先端状に、かつ先端部は球面状に形成されることを特徴とする。

[0031] 本発明は、前記複数の凸部上に形成された電気絶縁膜の凸部の高さは、10μm以下であることを特徴とする。

[0032] 本発明は、前記反射板は、前記一方基板上の液晶層側に不規則に配列される前記複数の凸部の直径は20μm以下であり、反射板総面積の40%以上を占めることを特徴とする。

[0033] また本発明は、前記反射板は、表示素子となる電極であることを特徴とする。

[0034] また本発明は、液晶層を介して対向配置される一対の基板の一方基板上に、他方基板側からの入射光を反射する反射板を有する反射型液晶表示装置の製造方法において、前記一方基板上の液晶層側に透光性樹脂を塗布し、前記透光性樹脂を円形の透光領域が不規則に配列された透光手段を介して露光および現像した後、熱処理を行い、得られた複数の凸部上に前記複数の凸部に合う絶縁膜を形成し、絶縁膜上に金属層から成る前記反射板を形成することを特徴とする反射型液晶表示装置の製造方法である。

[0035] さらにまた本発明は、前記透光手段は、前記円形の透光領域の総面積が反射板総面積の40%以上であり、かつ不規則に配列される前記円形の直径が20μm以下であることを特徴とする。

[0036]

[作用] 本発明に従えば、反射型液晶表示装置は、対向する一対の透明基板間に液晶層を介して形成される。このとき、一方の基板の液晶層側表面には、複数の反射電極と引出し電極とが形成され、他方の基板の液晶層側表面には共通電極が形成される。前記反射電極は表示素子であり、前述の他方基板および共通電極を介して入射する入射光を反射することによって表示が行われる。グ

ートバス配線、ソースバス配線および導線トランジスタなどで実装される前記引回し電極は、各反射電極に示すための電圧を印加する。他方基板の上に形成される前記共通電極は、他方基板のほぼ全面にわたって形成されている。

【0037】本発明の反射型液晶表示装置においては、前記一方基板上に形成されたゲートバス配線、ソースバス配線および導線トランジスタなどの引回し電極上であって、導線トランジスタのドレイン電極などと前記反射電極との接続部分を除く一方基板全面を覆い、引回し電極と重ならない前記反射電極形成領域のみに凸部を有する、たとえば高分子樹脂などから成る絶縁膜上に、反射電極が形成される。前述のように反射電極は、前記凸部上に形成されるため、反射電極表面にもまた前記凸部に対応する凸部が形成される。光反射面に凹凸を形成することによって、あらゆる角度からの入射光に対し、表示画面に垂直な方向へ散乱する光の強度が増加して表示輝度が向上し、表示のコントラストが向上することが知られている。前述のように、前記絶縁膜に形成されている凸部は、反射電極のみが形成される領域のみに形成されており、引回し電極上には形成されないため、凸部間の凹所が深く形成されることがあって、また、前記凸部と引回し電極とが接触する絶縁不良は生じない。また、引回し電極の上には、凸部が形成されていないため、前記反射電極の周縁部には凹凸がなく、前記反射電極のパターニングを良好に行うことができる。

【0038】また本発明に従えば、前記凸部が不規則に配列されており、前記凸部の形状が先細状であり、かつ先端部は球面状に形成されており、また前記凸部は1種類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成る。これらはいずれもあらゆる角度からの入射光に対し、表示画面に垂直な方向へ散乱する光の強度を増加する前述と同様な作用を有している。

【0044】また本発明に従えば、前記凸部の高さは10 μ m以下に選ばれる。通常、反射型液晶表示装置の液晶層の厚さは、10 μ m以下であるため、前記凸部の高さを液晶層の厚さよりも小さくすることによって液晶表示素子を均一に作成することができる。また、あらゆる角度からの入射光に対し、表示画面に垂直な方向へ散乱する光の強度を増加する前述と同様な作用を有している。

【0045】また本発明に従えば、前記一方基板上の液晶層側に配列される前記複数の凸部の断面形状の最大直径は20 μ m以下であり、反射板絶縁膜の40%以上を占めており、反射板は前記凸部に電気絶縁膜を介して形成されているため、高い反射率が得られる。前記反射板は、表示素子となる電極となる場合がある。この場合には、複差がなくなり、良好な表示が行える。

【0046】また本発明に従えば、液晶層を介在して対向配置される一方基板の上に、他方基板からの入射光を反射する反射板を有する反射型液晶表示装置を製造する場合、まず、一方の基板の液晶層側に感光性樹脂が塗布される。前記感光性樹脂は、不規則に配列された溝孔が形成された遮光手段を介して露光および現像された後に熱処理が行われ、これによって一方基板上に感光性樹脂から成る不規則な複数の凸部が形成される。前記凸部上に一方基板を覆うように絶縁膜が形成され、絶縁膜は前記凸部に対応した形状となる。さらにその上に、金属薄膜から成る反射板が絶縁膜表面の凸部に沿って形成される。

【0047】反射板表面の凸部は、感光性樹脂によって形成される凸部に対応している。感光性樹脂の形状は、容易に、かつ均一に再現性よく制御することが可能である。このように、容易に形成される絶縁膜の不規則な凸

部に対応して反射板の凸部が形成されるため、反射特性の良好な反射板を形成することができる。

【0048】また本発明に従えば、前記遮光手段は、前記凹形の遮光領域の絶縁膜が反射板絶縁膜の40%以上であり、かつ不規則に配列される前記凹形の直径が20 μ m以下であるため、高い反射率が得られる。

【0049】
【実施例】図1は、本発明の一実施例である反射型液晶表示装置30の断面図であり、図2は図1に示される基板31上の平面図である。ガラスなどから成る絶縁性の基板31上に、クロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線32が互いに平行に敷けられ、ゲートバス配線32からはゲート電極33が分岐している。ゲートバス配線32は、走査線として機能している。

【0050】ゲート電極33を覆って基板31上の全面に、酸化シリコン(SiN_x)、酸化シリコン(SiO₂)などから成るゲート絶縁膜34が形成されている。ゲート電極33の上方のゲート絶縁膜34上には、非晶質シリコン(以下、「a-Si」と記す。)、多結晶シリコン、CdSeなどから成る半導体層35が形成されている。半導体層35の両端部には、a-Siなどから成るコンタクト電極41が形成されている。一方のコンタクト電極41上には、タンタム、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極36が重量形成され、他方のコンタクト電極41上には、ソース電極36と同様にタンタム、モリブデン、アルミニウムなどから成るドレイン電極37が重量形成されている。

【0051】図2に示すようにソース電極36には、ゲートバス配線32に前述のゲート絶縁膜34を挟んで交差するソースバス配線39が接続されている。ソースバス配線39は、信号線として機能している。ソースバス配線39も、ソース電極36と同様の金属で形成されている。ゲート電極33、ゲート絶縁膜34、半導体層35、ソース電極36およびドレイン電極37は、薄膜トランジスタ(以下、「TFT」と記す。)40を構成し、該TFT40はスイッチング素子の機能を有する。

【0052】ゲートバス配線32、ソースバス配線39およびTFT40を覆って、基板31上全面に有機絶縁膜42が形成されている。有機絶縁膜42の反射電極43が形成される領域には、先細状で先端部が球面状に形成された、高さHの凸部42aが形成されており、ドレイン電極37の部分にはコンタクトホール43が形成されている。有機絶縁膜42の形成方法や、これにコンタクトホール43を形成する工程上の問題、および液晶表示装置30を作成する際の液晶層厚のバラツキを小さくするため、凸部42aの高さHは10 μ m以下である。有機

絶縁膜42の凸部42a形成領域上にアルミニウム、銀などから成る反射電極38が形成され、反射電極38はコンタクトホール43において、ドレイン電極37と接

接される。さらにその上には、配向膜44が形成される。

【0053】基板45上には、カラーフィルタ46が形成される。カラーフィルタ46は、基板31の反射電極38に対向する領域には、マゼンタまたは緑色のフィルタ46aが形成され、反射電極38に対向しない領域には黒色のフィルタ46bが形成される。カラーフィルタ46上の全面には、ITO(Indium Tin Oxide)などから成る透明電極47が形成され、さらにその上には配向膜48が形成される。

【0054】前記向基板31、45は、反射電極38とフィルタ46とが一対するように対向して配置せられ、基板間に液晶49が注入されて反射型液晶表示装置30が完成する。

【0055】図3は、図1および図2に示される凹凸を有する反射電極38を基板31上に形成する方法を説明する工程図であり、図4は図3に示す形成方法を説明する断面図であり、図5は図3の工程7で用いられるマスク51の平面図である。図4(1)は図3の工程5を示し、図4(2)は図3の工程7を示し、図4(3)は図3の工程8を示し、図4(4)は図3の工程9を示している。

【0056】工程1では、ガラスなどから成る絶縁性の基板31上にスパッタリング法によって3000Åの厚さのタンタル金属層を形成し、この金属層をホトリソグラフ法およびエッチングによってパターニングを行い、ゲートバス配線32およびゲート電極33を形成する。工程2では、プラズマCVD法によって4000Åの厚さの酸化シリコンから成るゲート絶縁膜34を形成する。

【0057】工程3では、半導体層35となる厚さ1000Åのa-Si層と、コンタクト層41となる厚さ400Åのn⁺型a-Si層とをこの順で連続的に形成する。形成されたn⁺型a-Si層およびa-Si層のパターニングを行い、半導体層35およびコンタクト層41を形成する。工程4では、基板31の全面に厚さ2000Åのモリブデン金属をスパッタ法によって形成し、このモリブデン金属層のパターニングを行う。ソース電極36、ドレイン電極37およびソースバス配線39を形成し、TFT40が完成する。図4(1)は、工程5までの処理終了後のTFT40が形成された基板31の断面図である。

【0058】工程5では、TFT40を形成した基板31上の全面にポリイミド樹脂を2 μ mの厚さに形成し、有機絶縁膜42を形成する。工程6では、ホトリソグラフィおよびドライエッチング法を用いて有機絶縁膜42にコンタクトホール43を形成する。工程7では、有機絶縁膜42上にホトリソレジスト50を塗布し、図5に示されるマスク51を用いて反射電極38形成領域に凸部50aをパターニングする。さらに、凸部50a

12

の角をとるために、120℃～250℃の範囲で熱処理を行う。本実施例では、200℃、30分の熱処理を行った。図4(2)に、工程s7までの処理終了後の基板31の断面図を示す。マスク511には、反射電極38形成領域に、図5に示されるように斜線で示す円形の透光領域51aが不規則に形成されている。

【0059】工程s8では、図4(3)に示されるように、ホトレジスト50を覆って有機絶縁膜42をエッチングして高さHが0.5μmの凸部42aを形成する。このとき、ホトレジスト52に熱処理を行い、凸部50aの角をとってあるため、凸部42aもまた角がとれた形に形成される。また、コンタクトホール43およびFT40上の有機絶縁膜42は、ホトレジスト50によって保護されており、エッチングは行われない。

【0060】工程s9では、有機絶縁膜42上全面にアルミニウム層を形成し、図4(4)に示されるように凸部42a上に反射電極38を形成する。この状態の基板31を、反射電極38を有する基板52とする。反射電極38は、有機絶縁膜42に形成されたコンタクトホール43を介してTFT40のドレイン電極37と接続されている。

【0061】有機絶縁膜42上の凸部42aの形状は、マスク511の形状、ホトレジスト50の厚さ、ドライエッチングの時間によって制御することができることが確認されている。

【0062】以上の工程によって、反射電極38を有する基板52を得た。また、上述の製造工程において、有機絶縁膜42のドライエッチング時間を長くして、凸部42aの高さHを1μmとした基板31を得ることができ、高さHが1μmである反射電極38を有する基板31を基板59とする。

【0063】図1に示される他方の基板45に形成される電極47は、たとえばITOから成り、厚さは1000Åである。配向膜44、48は、ポリイミドなどを塗布後、焼成することによって形成されている。基板31、45間には、たとえば7μmのスペースを挿入した図示しない導電性シール剤をスクリーン印刷することによって液晶49を封入する空間が形成され、前記空間を真空脱気することによって、液晶49が注入される。液晶49としては、たとえば黒色色素を混入したゲストホスト複合体(メルク社製、商品名ZLI2327)に、光学活性物質(メルク社製、商品名S811)を4.5%混入したものを用いる。

【0064】図6は、反射電極38を有する基板52、59の反射特性の測定法を示す断面図である。反射電極38を有する基板52、59上に紫外線硬化接着樹脂53を介してガラス基板54を密着し、測定用装置55を形成する。反射型液晶表示装置30において、基板45と液晶49との屈折率のいずれも約1.5であるので、紫外線硬化接着樹脂53および基板54の屈折率は約

反射電極38を形成した面が液晶49側に位置しているため、視差がなくなり、良好な表示画面が得られる。また、本実施例では、凹凸を有する反射電極38が液晶49側に、すなわち液晶49層にほぼ露出する位置に配置されている構成となるため、凸部42aの高さHは、液晶層厚よりも小さく、凸部の傾斜角度は液晶の配向を乱さない程度に抑えたいことが望ましい。

【0071】さらに、本実施例では、有機絶縁膜42のバターンニングをドライエッチング法によって行ったが、有機絶縁膜42がポリイミド樹脂の場合には、アルカリ溶液によるウェットエッチング法によって行ってもよい。また、有機絶縁膜42としてポリイミド樹脂を用いたが、アクリル樹脂などの他の有機材料を用いてもよい。さらに本実施例では、基板31、45として、ガラスなどから成る透明な材料を用いたが、シリコン基板のような不透明な材料でも同様な効果が得られ、この場合には回路を基板上に集積できる利点がある。

【0072】なお、前記実施例においては、表示モードとして縦転写型ゲスト・ホストモードを取上げたけれども、これに限定されることはなく、たとえば2層式ゲスト・ホストのような他の光吸収型モード、高分子分散型液晶表示装置のような光散乱型表示モード、強誘電性液晶表示装置で用いられる横置型表示モードなどでも同様の効果を得られる。また本実施例では、スイッチング素子としてTFT40を用いた場合について説明したけれども、たとえばMIM(Metal-Insulator-Metal)素子、ダイオード、バリスタなどを用いたアクティブマトリクス基板にも適用することができる。

【0073】図9は、本発明の他の実施例を示す基板31の平面図である。反射電極38上には、有機絶縁膜40に形成される凸部42aを介して凸部38aが不規則に形成されている。しかしながら、反射電極38の凸部38aの不規則さは、どの反射電極38をとっても同様である。これは、有機絶縁膜42上に凸部42aを形成する際に用いられるホトマスク51の各反射電極38に対応する領域に、同じ配列パターンで透光領域51aを形成しているためである。

【0074】凸部42aを形成するためのホトマスク51の各反射電極38に対応する領域に、それぞれ異なる配列パターンの透光領域51aを設計することもできるけれども、このような方法を採ると、配列パターンの形成に必要とされるデータ量が増大し、ホトマスク51の作成が困難となる。しかしながら本実施例によれば、各反射電極38に対応する領域のホトマスク51上には、それぞれ同じ配列パターンで透光領域51aが形成されるため、1反射電極38に対応する配列パターンを形成するだけでよく、ホトマスク51の作成が容易となる。

【0075】また図9に示される凸部42aは、2種類の円形の透光領域が不規則に配列されているホトマスクを用いて形成されている。凸部38aの大きさは、たと

13

14

えば断面形状の最大直径を5μmと10μmとし、高さは0.6μmとし、それらが1反射電極38に対応する領域のみランダムに形成し、残りの領域はその配列パターンを繰返している。たとえば、領域の大きさは、300μm×300μm、総素数320×240、対角サイズ5インチであるようなモノクロ反転型液晶表示装置を作成した。

【0076】なお、反射型液晶表示装置30の構成、凸部42aの作成方法、表示モードなどは前述の実施例と同様である。全面点灯させたときの表示は、隣の領域と干渉による色は見えず、良好な白色が得られた。

【0077】反射電極38の数が多くなり、反射電極39のピッチが小さくなったときに、特に隣の反射電極38が形成する領域との干渉色が問題となる場合には、2種類以上の配列パターンを組合せてホトマスク51を形成すればよい。

【0078】以上のように本実施例によれば、反射電極38部分のみに凹凸を形成するため、ソースバス配線39と反射電極38との焼結不良が生じず、また反射電極38周縁部の有機絶縁膜42上は凹凸がなく平坦であるためバターンニング不良は生じず、反射型液晶表示装置30の表示品位が向上する。また、反射電極38部分に形成される凸部42aは不規則に配置され、また先端部が先端部は端面状に形成され、1種類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成るため、反射型液晶表示装置30の法線方向への拡散光の強度が向上する。

【0079】また本実施例によれば、前記凸部42aの配列パターンが各反射電極38において同一であるため、容易に凸部の形成を行うことができる。

【0080】図10は、本発明のさらに他の実施例である反射型液晶表示装置130の断面図であり、図11は図10に示される基板131の平面図である。ガラスなどから成る絶縁性の基板131上に、クロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線132が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線132からはゲート電極133が分岐している。ゲートバス配線130には、走査線として機能している。

【0081】ゲート電極133を覆って基板131上の全面に、酸化シリコン(SiN_x)、酸化シリコン(SiO₂)などから成るゲート絶縁膜134が形成されている。ゲート電極133の上のゲート絶縁膜134上には、非晶質シリコン(以下、「a-Si」と記す。)、多結晶シリコン、CdSeなどから成る半導体層135が形成されている。半導体層135の両端部は、a-Siなどから成るコンタクト電極141に形成されている。一方のコンタクト電極141上には、チャレン、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極136が重畳形成され、他方のコンタクト電極141上には、ソース電極136と同様にチャレン、モリブデン、アルミニウムなどから成るドレイン電極137が重畳形

成されている。

【0082】図11に示すように、ソース電極136には、ゲートバス配線132と前述のゲート絶縁膜134を挟んで交差するソースバス配線139が接続されている。

ソースバス配線139は、信号線として機能している。ソースバス配線139は、ソース電極136と同様の金属で形成されている。ゲート電極133、ゲート絶縁膜134、半導体層135、ソース電極136およびドレイン電極137は、薄膜トランジスタ（以下、「TFT」と記す。）140を構成し、該TFT140は、スイッチング素子の機能を有する。

【0083】反射電極138が形成される領域には、複数の凸部142aが不規則に形成されている。ゲートバス配線132、ソースバス配線139、TFT140および凸部142aを覆って、基板131上全面に有機絶縁膜142が形成されている。有機絶縁膜142は、凸部142aに応じた凸部142bが生じる。ドレイン電極137部分には、コンタクトホール143が形成される。液晶表示装置130を作成する際の液晶層層のバライズを小さくするため、凸部142bの高さH1

20は液晶層の厚さより小さい0.10 μ m以下が好ましい。一般に、液晶層の厚さは10 μ m以下であるためである。また、凸部142aのピッチは、100 μ m以下が好ましい。凸部142aが形成されている領域上の有機絶縁膜142上にアルミニウム、銀などから成る反射電極138が形成され、反射電極138はコンタクトホール143においてドレイン電極137と接続される。さらに、その上に配向膜144が形成される。

【0084】反射電極138は、図11に示されるように、ゲートバス配線132の上部およびソース電極139の一部に有機絶縁膜142を介して重畳されるように形成されている。このため、反射電極138の面積を大きくすることができ、表示面の開口率が大きくなり、明るい表示が可能となる。反射電極138のパターニング不良をなくするためには、反射電極138の周縁部には、凸部142aを形成しない構成とすればよい。また、反射電極138とゲートバス配線132およびソースバス配線139との絶縁不良が生じるときには、重畳する部分には凸部142aを形成しない構成とすればよい。

【0085】基板145上には、カラーフィルタ146が形成される。カラーフィルタ146は、基板131の反射電極138に対向する領域には、マゼンタまたは緑色のフィルタ146aが形成され、反射電極138に對向しない領域には、黒色のフィルタ146bが形成される。カラーフィルタ146上の全面には、ITOなどから成る透明電極147、さらにその上に配向膜148が形成される。

【0086】同基板131、145は、反射電極138とフィルタ146aとが一致するように間隔をあけて配置されている。

れるように、有機絶縁膜142を形成する。工程a7では、ボトリングラフ法およびドライエッチング法を用いて有機絶縁膜142にコンタクトホール143を形成する。

【0092】工程a8では、凸部142bを有する有機絶縁膜142上全面に図13（4）に示されるようにアルミニウムから成る金属層を形成し、工程a9では図13（5）に示されるように凸部142b上に反射電極138をパターンニングする。反射電極138は、有機絶縁膜142に形成されたコンタクトホール143を介してTFT140のドレイン電極137と接続されている。反射電極138のパターンニング時に、有機絶縁膜142の下のホトレジストから成る凸部142aは、露光、現像、アルミニウムのエッチング、レジストの剥離の工程を通して、何の変化も見られないことを確認している。

【0093】凸部142aの形状は、マスク151の形状、凸部142aとなるホトレジストの厚さによって制御することができる。凸部142aの角は、凸部142aの形成後、熱処理をすることによって容易にすることができる。

【0094】図10に示される他方の基板145に形成される電極147は、たとえばITOから成り、厚さは1000Åである。電極138、147上の配向膜144、148は、ポリイミドなどを塗布後、焼成することによって形成されている。基板131、145間には、たとえば7 μ mのスペーサを挿入した図示しない接合性シール層をスクリーン印刷することによって、液晶149を封入する空間が形成され、前記空間を真空脱気することによって液晶149が注入される。液晶149としては、たとえば黒色色素を混入したダストホスト液晶（メルク社製、商品名 ZLI2327）に、光学活性物質（メルク社製、商品名 S811）を4.5%混入したのを用いる。

【0095】図15は、本発明の反射型液晶表示装置130の反射特性の測定に用いられる反射板170の製造工程を説明する工程図であり、図16は図15の各工程を説明する断面図である。工程b1では、図16（1）に示すように、厚さ1.1mmのガラス（商品名 7059 コーニング社製）171の一方表面に、レジスト材料として、たとえばOFFR-800（東京応化社製）を好ましくは500 μ m \sim 3000 μ mでストンコートによって塗布する。本実施例では、3000 μ mで30秒間塗布し、レジスト172を1.2 μ m成膜した。

【0096】工程b2では、レジスト172を100℃で30分間プリベークし、工程b3では、図16（2）に示すように、レジスト172上に円形の透光領域151a、151bを有するホトマスク151を配置して露光を行い、工程b4では、図16（3）に示すように、

レジスト172を現像し、基板171表面に不規則な略円柱形の凸部174を形成した。現像液として、2.38%のNMD-3（東京応化社製）を用いた。

【0097】工程b5では、ガラス基板171上の凸部174を好ましくは120℃ \sim 250℃で熱処理する。と、図16（4）に示されるように角はとれて表面の滑らかな凸部174が形成される。本実施例では、180℃で30分間熱処理を行った。工程b6では、図16（5）に示すように凸部174を形成した基板171上に有機絶縁膜174aを形成した。有機絶縁膜174aとしては、ポリイミド樹脂を好ましくは920 μ m \sim 3500 μ mで30秒間スピニングによって塗布する。本実施例では、2200 μ mで20秒間塗布し、1 μ mの厚さの有機絶縁膜174aを成膜した。有機絶縁膜174aには、凸部174に応じた凸部が生じるが、凸部174よりは滑らかである。

【0098】工程b7では、図16（6）に示すように有機絶縁膜174a上に金属層膜175を形成した。金属層膜175としては、アルミニウム、ニッケル、クロム、銀、銅などが挙げることができる。金属層膜175の厚さは、0.01 μ m \sim 1.0 μ m程度が適している。本実施例では、アルミニウムを真空蒸着することによって金属層膜175を形成した。金属層膜175は、凸部174に沿って形成された有機絶縁膜174a上に形成されているため、凸部174に応じた不規則な円形の凸部175aを有している。以上によって反射板170を得た。

【0099】図17は、反射板170の反射特性の測定法を説明する断面図である。通常、液晶表示装置130に用いられる基板131、145および液晶149層の間折率は、それぞれ約1.5である。反射板170の表面と、液晶149層とが接する構成を想定し、本実施例では屈折率1.5の紫外線硬化樹脂177を用いてガラス基板176を反射板170に密着させて、反射板170の反射特性を測定した。この測定結果は、反射板170の表面と液晶149層の境界における反射特性と同一の結果を与えることを確認している。

【0100】図17に示すように、反射特性の測定は、反射板170に入射する入射光179の散乱光180をホトマルチメータ178で検出することによって行われ、反射板170には、その法線に対し角度 θ をもって入射光179が入射する。ホトマルチメータ178は、金属層膜175上の入射光179が照射される点を通る反射板170の法線方向に固定されている。入射光179の入射角度 θ を代えて入射光179の急激な傾斜175による散乱光180の強度を測定することによって反射特性が得られた。

【0101】図18は、入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。入射角度 θ である入射光179の反射強度は、 $\theta=0^\circ$ の線に対する角度 θ の方向に、原

点0からの距離として表されている。 $\theta = 70^\circ$ の反射強度をP1、 $\theta = 60^\circ$ の反射強度をP2、 $\theta = 40^\circ$ の反射強度をP3、 $\theta = 30^\circ$ の反射強度をP4、 $\theta = -30^\circ$ の反射強度をP5、 $\theta = -40^\circ$ の反射強度をP6、 $\theta = -60^\circ$ の反射強度をP7、 $\theta = -70^\circ$ の反射強度をP8で示している。

[0102] 図18では、酸化マグネシウムの標準白色板の反射特性曲線を破線81で示している。 $\theta = 30^\circ$ の反射強度P4は、 $\theta = 30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P10よりも優れており、 $\theta = -30^\circ$ の反射強度もまた $\theta = -30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P11よりも優れていることが判る。

[0103] 以上のように本実施例によれば、形状の制御が容易であり、再現性を有するホトレジストから成る凸部142a上に凸部142aに沿って形成された凸部142bを有する有機絶縁膜142上に、凸部142bに沿った反射電極138を形成する。凸部142aの形状を制御することによって、良好な反射特性を有する反射電極138が得られ、反射型液晶表示装置130の表示位が向上する。

[0104] 前述のホトレジスト151は、図19に示すようなものを用いるのが好ましい。図19(1)では、遮光領域151a、151bの総面積がマスク151の総面積の約47%であり、図19(2)では遮光領域151a、151bの総面積がマスク151の総面積の41%である。

[0105] 図20は、遮光領域151a、151bが総面積の40%以上を占めるマスク51、151を用いて形成された反射電極75、175における入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。入射角度 θ である入射光78、178の反射強度は、 $\theta = 0^\circ$ の線に対する角度 θ の方向に、原点0からの距離として表されている。 $\theta = 70^\circ$ の反射強度をP21、 $\theta = 60^\circ$ の反射強度をP22、 $\theta = 40^\circ$ の反射強度をP23、 $\theta = 30^\circ$ の反射強度をP24、 $\theta = 25^\circ$ の反射強度をP25、 $\theta = -25^\circ$ の反射強度をP26、 $\theta = -30^\circ$ の反射強度をP27、 $\theta = -40^\circ$ の反射強度をP28、 $\theta = -60^\circ$ の反射強度をP29、 $\theta = -70^\circ$ の反射強度をP30で示している。

[0106] 図20では、また酸化マグネシウムの標準白色板の反射特性曲線を破線181で示している。 $\theta = 30^\circ$ の反射強度P24は、 $\theta = 30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P34よりも優れており、 $\theta = -30^\circ$ の反射強度P27もまた $\theta = -30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P37よりも優れていることが判る。

[0107] これに対し、遮光領域151a、151bが地面積の40%未満、たとえ35%のホトレジスト51を用いて、同様の方法で反射板の反射特性を図21に示す。 $\theta = 30^\circ$ の反射強度P54は、 $\theta = 30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P44よりも劣っており、 θ

$= -30^\circ$ の反射強度P57もまた $\theta = -30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P47よりも劣っていることが判る。これは、凸部が40%未満であると、正反射成分が非常に多く、散乱が少ないため視野が狭められていたと考えられる。

[0108] 図22は、遮光領域151a、151bのマスクの地面積に占める割合を変化させたホトレジスト51を用いて作成した反射板の $\theta = 30^\circ$ での反射率を示す。図22から凸部の割合を40%以上とすることによって高い反射率の反射板が得られることが判る。この他に、ホトレジストの種類や、膜厚、熱処理温度を選択することによって、凸部の傾斜角度を自由に制御することができ、これによって反射特性を制御できる。また、有機絶縁膜の種類や膜厚によっても反射特性を制御できる。

[0109] 本実施例の反射型液晶表示装置130では、反射電極138を形成した面が液晶149側に位置しているため視差がなくなり、良好な表示面が得られる。また本実施例では、凹凸を有する反射電極138が液晶149層側、すなわち液晶149層にほぼ隣接する位置に配置されている構成となるため、凸部142bの高さH1は、液晶層厚よりも小さく、凸部の傾斜角度は液晶分子の配向を乱さない程度に穏やかにすることができ、また本実施例では、反射電極138形成領域のみ、凸部142aを形成しただけでも、基板131全面に凸部142aを形成してもよい。また、反射電極138を透明電極として、別に反射板を設けてもよく、この場合にも同様に、不規則な複数の凸部上に形成された有機絶縁膜上に反射板が形成される。また、スイッチング素としてTFT140を用いるアクティブマトリクス駆動方式の反射型液晶表示装置130について説明したけれども、これに限られるものではなく、単地マトリクス駆動方式などの反射型液晶表示装置でも同様の効果が得られる。

[0110] さらに、本実施例では有機絶縁膜142のバタニニングをドライエッチング法によって行ったが、有機絶縁膜142がポリイミド樹脂の場合には、アルカリ溶液によるウエットエッチング法によって行ってもよい。また、有機絶縁膜142としてポリイミド樹脂を用いたが、アクリル樹脂などの他の有機材料を用いてもよい。さらに本実施例では、基板131として、ガラスなどから成る透明な材料を用いたが、シリコン基板のような不透明な材料でも同様な効果が得られ、この場合には回路を基板上に集積できる利点がある。

[0111] なお、前記実施例においては、表示モードとして相転移型ゲスト・ホストモードをとってあげたけれども、これに限定されることはなく、たとえばゲスト・ホストのような他の光吸収モード、高分子分散型液晶表示装置のような光散乱型表示モード、強誘電性液晶表示装置や使用される複屈折表示モードなどでも同様

の効果が得られる。また本実施例では、スイッチング素としてTFTを用いた場合について説明したが、たとえばMIM (Metal-Insulator-Metal) 素子、ダイオード、バリスタなどを用いたアクティブマトリクス基板に適用することができ。

[0112] 図23は、本発明のさらに他の実施例を説明するための断面図である。本実施例の特徴は、前述の図2に示すように凹凸を形成した反射型アクティブマトリクス基板31上に、電気絶縁性材料から成る黒色遮光層71を形成したことである。黒色遮光層71は、図23において斜線を付した領域、すなわち、反射電極38以外の領域とTFT40を構成する半導体層35の形成領域とに形成される。なお、前述の図10および図11に示される反射型アクティブマトリクス基板131上に黒色遮光層71を形成してもよい。

[0113] 図24は、黒色遮光層71の形成方法を説明するための断面図である。ここでは、図6に示されるアクティブマトリクス基板31を例にとり説明するが、アクティブマトリクス基板131の明部も同様である。

[0114] 先ず、基板31の全面に、図24(1)に示すように、可視光を吸収するように赤色、青色、緑色の染料をそれぞれ分散させた感光性アクリル樹脂、たとえば富士バント社製、商品名 カラモザイクCR、C G、CBを3種類混ぜ合わせて黒色を呈した樹脂71をスピンナーを用いて塗布する。

[0115] 続いて、図24(2)に示すように、所定のマスケ72を用いて露光し、現像後に、反射電極38以外の領域と、TFT41を構成する半導体層35の形成領域と完全に覆うように、不要な部分をエッチングによって取除いて、図24(3)に示すように、黒色遮光層71を形成した。その後、200℃で1時間加熱し、黒色遮光層71を硬化させた。

[0116] 以上のように本実施例によれば、黒色遮光層71を形成して反射電極38以外の部分の反射光（散乱光）を遮るようにしたので、表示に不必要な光の漏れを防止することができ、コントラストの優れた反射型液晶表示装置を実現することができ、また、対向する基板45上に黒色遮光層71を形成する場合に比べて、基板45上を露光する際の開口率の低下を少なくした明り合いを実現することができる。

[0117] 本実施例では、黒色遮光層71の材料として、染料を分散させたアクリル樹脂を用いたが、カーボンを分散させたアクリル樹脂、たとえば富士バント社製、商品名 カラモザイクBKのような有機材料や、アルファシリコングループのシリコン（a-SiGe）、あるいは銀や無機メタリなどの無機物も適用可能である。また、黒色遮光層71の厚みは、用いる材料の吸収係数を考慮して、好ましくは透過率を少なくとも5%以下に、より好ましくは1%以下になるように設定

する必要がある。

[0118]

[発明の効果] 以上のように本発明によれば、反射電極は引直し電極と重ならない反射電極形成領域のみに複数凸部を有する絶縁膜上に形成される。絶縁膜上の凸部の形成不良が生じても、引直し電極上には凸部が形成されない。反射電極と引直し電極との絶縁不良は生じない。

[0119] また、前述のように反射電極周縁部の絶縁膜には凸部が形成されておらず、平坦なため、反射電極のバタニニングが良好となる。したがって、表示位が向上する。また、前記凸部は不規則に形成され、凸部の形状は先細状で、かつ先端が稜面状であり、また前記凸部は1種類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成るため、あらゆる角度からの入射光に対する表示面へ垂直な方向に散乱する光の強度が増加して表示機能が向上し、表示のコントラストが向上するため、表示位が向上する。

[0120] また本発明によれば、前記凸部の配列パターンは各反射電極において同一であり、前記凸部を形成する際に用いる配列パターンを1種類用意するだけでよく、凸部の形成が容易となる。

[0121] さらに本発明によれば、一方基板上に電気絶縁性を有する遮光膜を形成して、反射電極以外の部分の反射光を遮るようにしたので、表示に不必要な光の漏れを防止することができ、コントラストの優れた反射型液晶表示装置を実現することができ、また、他方基板上に遮光膜を形成する場合に比べて、基板45を露光する際の開口率の低下を少なくした明り合いを実現することができる。

[0122] また本発明によれば、感光性樹脂を露光、現像し、熱処理を行って得られた複数の不規則な凸部上に形成された絶縁膜上に、金属薄膜から成る反射電極を絶縁膜の凸部に沿って形成する。反射電極の形状は、感光性樹脂の形状によって決定される。感光性樹脂は、容易に、かつ均一に再現性よく制御することが可能であるため、良好な反射特性を有する反射電極が容易に形成することができ、反射型液晶表示装置の表示位が向上する。

[0123] また不規則に配列された複数の凸部に沿って反射電極を形成するため、良好な反射特性が得られ、反射型液晶表示装置の表示位が向上する。

[0124] さらに、前記反射電極が表示素子となる電極である場合には、視差がなくなり、反射型液晶表示装置の表示位がさらに向上する。

[図面の簡単な説明]

[図1] 本発明の一実施例である反射型液晶表示装置30の断面図である。

[図2] 図1に示される基板31の平面図である。

[図3] 図1および図2に示される基板31上に凸部を

23

有する反射電極38を形成する形成方法を説明する工程図である。

【図4】図3に示す形成方法を説明する断面図である。

【図5】図3の工程s7で用いるマスク51の平面図である。

【図6】反射電極38を有する基板52の反射特性の測定法を示す断面図である。

【図7】本発明の反射型アクティブマトリクス基板52、53の反射特性60、61を示すグラフである。

【図8】本発明の一実施例である反射型液晶表示装置30の白色光輝光に対する反射光の色をCIE色度図に示したグラフである。

【図9】本発明の他の実施例を示す基板31の平面図である。

【図10】本発明のさらに他の実施例である反射型液晶表示装置130の断面図である。

【図11】図10に示される基板131の平面図である。

【図12】図10および図11に示される凸部を有する反射電極138を形成する形成方法を説明する工程図である。

【図13】図12に示す形成方法を説明する断面図である。

【図14】図12の工程a5で用いるマスク151の平面図である。

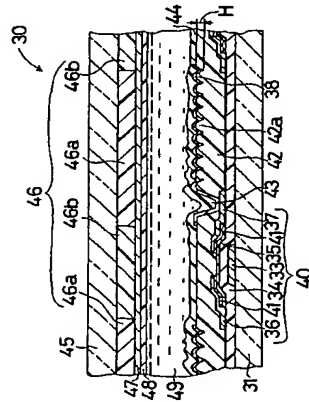
【図15】本発明の反射型液晶表示装置130の反射特性の測定に用いられる反射板170の製造工程を説明する工程図である。

【図16】図15の工程を説明する断面図である。

【図17】反射板170の反射特性の測定法を説明する斜視図である。

【図18】入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。

【図1】



24

【図19】マスク51を示す平面図である。

【図20】透光領域51a、151aの総面積がマスクの総面積の40%以上であるマスク51を用いて形成された反射電極75における入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。

【図21】透光領域151aの総面積が全体の35%を占めるマスク151を用いて形成された反射電極75における入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。

【図22】透光領域の割合と反射率との関係を示すグラフである。

【図23】本発明のさらに他の実施例を説明するための平面図である。

【図24】黒色遮光層71の形成方法を説明するための断面図である。

【図25】アクティブマトリクス方式に用いられるスイッチング素子である薄膜トランジスタ1を有する基板2の平面図である。

【図26】図25に示される切断面線X26-X26から見た断面図である。

【図27】アクティブマトリクス方式に用いられるスイッチング素子である薄膜トランジスタ11を有する基板12の平面図である。

【図28】図27に示される切断面線X28-X28から見た断面図である。

【符号の説明】

30、130 反射型液晶表示装置

31、45、131、145 基板

38、138 反射電極

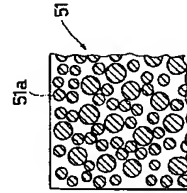
42、142 有機絶縁膜

42a、142a 凸部

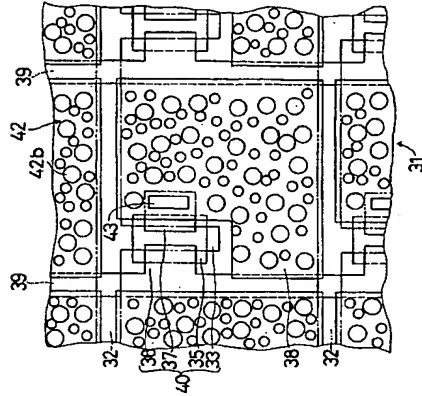
49、149 液晶

51、151 ホットマスク

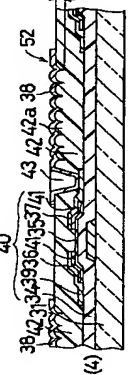
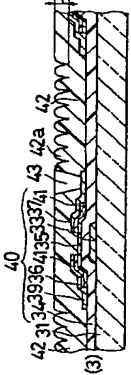
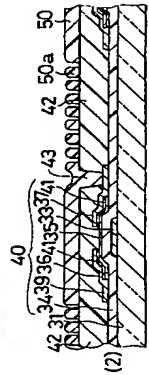
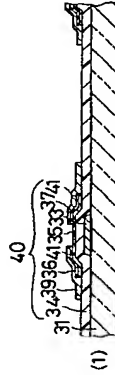
【図5】



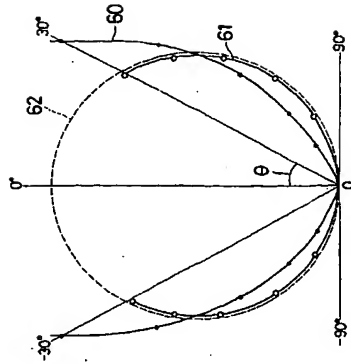
【図2】



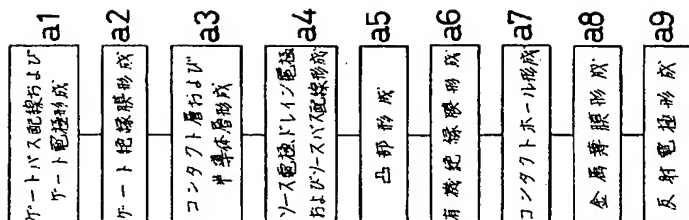
【図4】



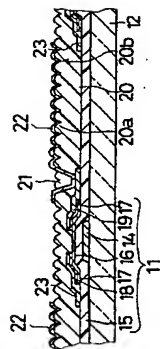
【図7】



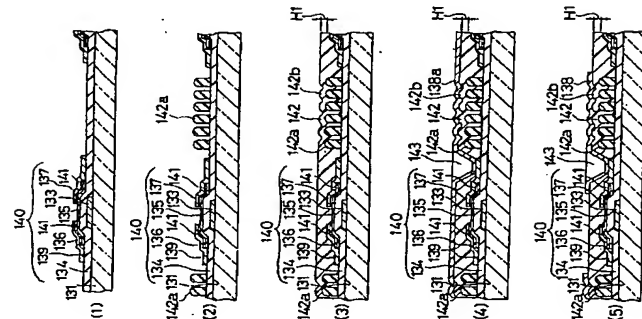
【図12】



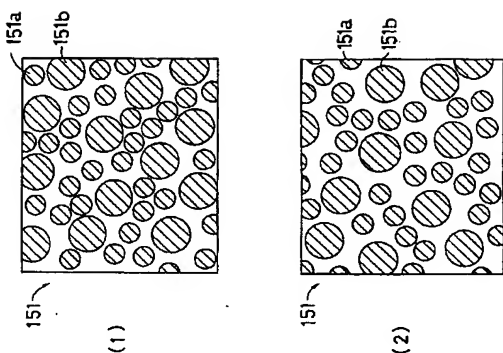
【図28】



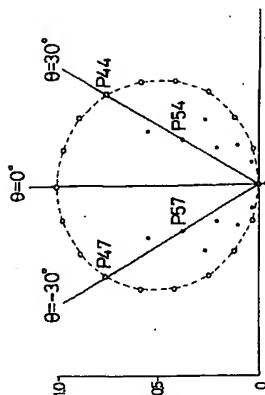
【図13】



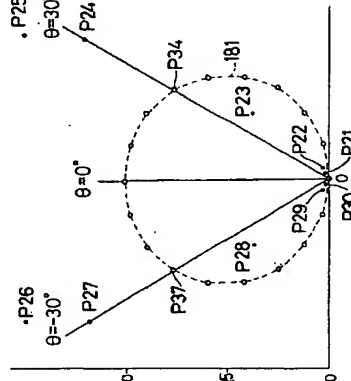
【図19】



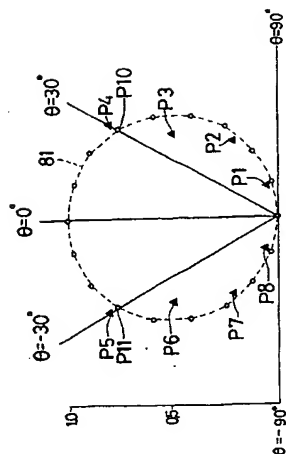
【図21】



【図20】



【図18】



特開平 6 - 7 5 2 3 8

(21)

フロントページの続き

(72)発明者 神戸 誠

大阪府大阪市阿倍野区豊池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内

(72)発明者 島田 康彦

大阪府大阪市阿倍野区豊池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内

THIS PAGE BLANK (USPTO)